

2. Workshop Angewandte Simulation in der Kristallzüchtung Memmelsdorf 2002

Generation, Dynamik und Konfiguration von Versetzungsstrukturen

Hartmut S. Leipner





Interdisziplinäres Zentrum für Materialwissenschaften

Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg

http://www.cmat.uni-halle.de

Übersicht

- CRSS
- Skalen: Makro, Meso, Mikro
- Simulation der Versetzungsbewegung
- Musterbildung
- Versetzungskernstruktur

Weertmandiagramm



Dominierende Kriechmechanismen als Funktion der Temperatur und Spannung

Kritische Schubspannung

- Einsetzen plastischer Prozesse bei CRSS (*critical resolved shear stress*) τ_{c}
- existiert keine eindeutige Definition
- vorhandene Versetzungsstruktur im Kristall spiegelt komplette thermo-mechanische Historie wider, die sich nicht an einzelner Spannung festmachen lässt
- Versetzungsbewegung als thermisch aktivierter Prozess der Kinkenbildung und -migration ohne Schwellwert τ_c
- praktikabel f
 ür Kristallwachstum: CRSS als ein bestimmter
 Übergangsbereich; bei geringeren Spannungen keine Deformation innerhalb endlicher Beobachtungszeit messbar

Modelle der plastischen Deformation



Alexander–Haasen-Modell

• Grundlage *Orowangleichung*: $v = v(T, \tau, \rho), \rho = \rho(T, \tau)$

$$\dot{\varepsilon} = f b \rho v$$

 $do - K\tau \quad o dr$

- Versetzungsmultiplikation
- *effektive Spannung*
- Versetzungsgeschwindigkeit

$$dp = m_{eff} p dx$$

 $\tau_{\rm eff} = \tau - A \sqrt{\rho}$

$$v = B \tau_{\rm eff}^{m} \exp\left(-\frac{Q}{k_{\rm B}T}\right)$$

Zustandsgleichungen

• phänomenologische Zustandsgleichungen der plastischen Deformation

$$\frac{\mathrm{d}\,\varepsilon}{\mathrm{d}\,t} = f\,b\,\rho\,B\exp\left(-\frac{Q}{k_{\mathrm{B}}T}\right)\left(\tau - A\,\sqrt{\rho}\right)^{m}$$
$$\frac{\mathrm{d}\,\rho}{\mathrm{d}\,t} = K\,\rho\,B\exp\left(-\frac{Q}{k_{\mathrm{B}}T}\right)\left(\tau - A\,\sqrt{\rho}\right)^{m+1}$$

- geeignete Beschreibung f
 ür eine Reihe von Element- und Verbindungshalbleitermaterialien
- Problem bei Verbindungshalbleitern:
 verschiedene polare Versetzungstypen (α, β)

Simulation von Verformungskurven



Spannungs–Dehnungs-Kurven von GaAs. (a) Kompressionsexperimente in [213]-Richtung bei verschiedenen Temperaturen mit einer Dehnungsrate von $2 \cdot 10^{-4}$ s⁻¹, (b) berechnete Kurven.

[Sumino 1994]

Parameter der Versetzungsgeschwindigkeit

Material	Versetzungstyp	$B \text{ (m/s MPa}^{-m})$	т	$Q(\mathrm{eV})$	$T/T_{\rm m}({\rm K/K})$
Si	60°	1,0.104	1,0	2,20	0,52—0,63
	Schraube	$3,5.10^{4}$	1,0	2,35	
GaAs	α	1,9·10 ³	1,7	1,00	0,38—0,61
	β	$5,9.10^{1}$	1,6	1,30	
	Schraube	$1,2.10^{2}$	1,8	1,40	
InP	α	4,0 ·10 ⁴	1,4	1,60	0,51—0,78
	β	5,0·10 ⁵	1,8	1,70	
	Schraube	4,0.104	1,7	1,70	

[Sumino, Yonenaga 1993; Alexander, Gottschalk 1989]

Hirth–Lothe-Modell

- physikalische Interpretation der empirischen Formel f
 ür die Versetzungsgeschwindigkeit: Bildung und Migration von Doppelkinken
- Hirth–Lothe-Modell

v = hLJ	für $L < 2\lambda$	(a)
$v = h\lambda J$	für $L > 2\lambda$	(b)

- mittlere freie Weglänge der Kinken
- Einsteinbeziehung für Kinkengeschwindigkeit

$$v_{\rm k} = \frac{b \, h \, \tau_{\rm eff}}{k_B T} D_{\rm k}$$

• mit den entsprechenden Beziehungen für J, D_k ergibt sich im Fall (b)

$$v = \frac{b h^2 h_2 v_{\rm D}}{k_{\rm B} T} \tau_{\rm eff} \exp\left(\frac{S}{k_{\rm B}}\right) \exp\left(-\frac{W_{\rm m} + U_{\rm k}}{k_{\rm B} T}\right)$$

 $\lambda = 2 \sqrt{\frac{v_k}{I}}$

Versetzungsgeschwindigkeit



- Aktivierungsenergie der Versetzungsgeschwindigkeit $Q = W_{m} + U_{k}$
- keine theoretische Begründung für Spannungsexponenten *m*
- Problem des Geltungsbereichs des HL-Modells (Spannungen, Temperaturen; Wechselwirkungen mit Fremdatomen)
- Welche Energie ist größer: Kinkenbildungs- oder Kinkenmigrationsenergie? Silicium: $W_{\rm m} = 1.2 \text{ eV}, F_{\rm k} = U_{\rm k} - TS = 0.7 \text{ eV}$ für 90°-Partialversetzung

Schoeckformalismus

• plastische Verformungsrate als Funktion der Gibbschen Energie, die notwendig ist, um Gleithindernis zu überwinden

$$\dot{\varepsilon} = \dot{\varepsilon}_{0} \exp\left[-\frac{\Delta G(\tau_{\text{eff}}, T)}{k_{\text{B}}T}\right]$$

- Aktivierungsenergie abhängig von Schubspannung $\Delta G = \Delta G_0 V \tau_{eff}$
- Aktivierungsvolumen $V = b d\Lambda$



Modellvergleich

- empirische Beschreibung von AH repräsentiert experimentelle Befunde in hochreinen Halbleitern besser als das thermodynamische Schoeckmodell
- Schoeckmodell adäquat bei sehr hoher Spannung (bzw. in Materialien mit kleiner Peierlsbarriere)
- keine physikalische Bedeutung der Parameter *B*, *m*
- Spannungsrelaxationsexperimente:

$$V = k_{\rm B} T \left(\frac{\partial \ln \dot{\varepsilon}}{\partial \tau} \right)_T$$

$$2 + m = \left(\frac{\partial \ln \dot{\varepsilon}}{\partial \ln \tau}\right)_T$$

Spannungsexponent keine Konstante, sondern steht in Beziehung zum Multiplikationsmechanismus der Versetzungen

Versetzungsgeneration während des Kristallwachstums

- Kombination der Berechnung thermischer Spannungen mit der plastischen Relaxation während des Wachstums
- Zustandsgleichungen des AH-Modells + Modellierung von Spannung und Verzerrung im sich abkühlenden Kristall
- Gesamtverzerrung eines Volumenelements:



• Verformungsrate

$$d\varepsilon_{t}(t)/dt = d\varepsilon_{elast,res}(t)/dt + d\varepsilon_{pl}(t)/dt$$

Thermoelastisches Modell



Stationäres T(r, z)-Feld

- Berechnung thermischer Spannungen in Zylinderkoordiaten
- Annahme:
 isotropes Material, axialsymmetrischer Kristall
- zweidimensionales thermoelastisches Modell
- Thermische elastische Spannungskomponenten $\sigma_{rr}, \sigma_{\theta\theta}, \sigma_{zz}, \sigma_{rz} \rightarrow$ Transformation auf jedes Gleitsystem, um Versetzungsbewegung zu simulieren

Thermoelastische Spannung

- Inhomogeneo Temperaturverteilung ist gekoppelt mit lokal unterschiedlischer Kontraktion/Expansion
- Spannung und Verzerrung über Hookebeziehung verknüpft
- Annahme: völlig elastisches Verhalten im gesamten Temperaturbereich
- Theorie der Thermoelastizität,
 - z. B. Timoshenko: Theory of elasticity (1951)
- Einfache Regeln:
 - **1.** ein Temperaturfeld, welches linear in allen Koordinaten ist, ergibt einen spannungsfreien Zustand (freie Temperaturbiegung)
 - 2. Skaleninvarianz von Längen und Temperaturdifferenzen
 - 3. Inkompatibilitäten des Temperaturfeldes sind Quellen von Spannungen

Visualisierung des Spannungszustandes



$$\sigma_{\rm vM} = \sqrt{\frac{(\sigma_{\rm rr} - \sigma_{\rm zz})^2 + (\sigma_{\rm zz} - \sigma_{\theta\theta})^2 + (\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{\rm rr})^2 + 6\sigma_{\rm rz}^2}{2}}$$

Berechnung der Versetzungsdichte

 System gekoppelter Differentialgleichungen f
ür die fortschreitende plastische Deformation in einem Volumenelement des wachsenden Kristalls

$$\frac{\mathrm{d}\,\varepsilon_{\mathrm{elast \, res}}(t)}{\mathrm{d}\,t} + \frac{G}{f} \frac{\mathrm{d}\,\varepsilon_{\mathrm{pl}}(t)}{\mathrm{d}\,t} = \frac{\mathrm{d}\,\varepsilon_{\mathrm{t}}^{\mathrm{slip}}(t)}{\mathrm{d}\,t}$$
$$\frac{\mathrm{d}\,\varepsilon_{\mathrm{pl}}(t)}{\mathrm{d}\,t} = f\,b\,\rho(t)B\exp\left(-\frac{Q}{k_{\mathrm{B}}T}\right)\left(\varepsilon_{\mathrm{elast \, res}} - A\,\sqrt{\rho}\right)^{m}$$
$$\frac{\mathrm{d}\,\rho(t)}{\mathrm{d}\,t} = K\,\rho(t)B\exp\left(-\frac{Q}{k_{\mathrm{B}}T}\right)\left(\varepsilon_{\mathrm{elast \, res}} - A\,\sqrt{\rho}\right)^{m+1}$$

- Berechnung für bestimmtes Gleitsystem
- Versetzungsdichte im Volumenelement durch Integration der Gleichungen über die gesamte Zeit des Wachstums
- numerische Lösung

Versetzungsverteilung



Versetzungsdichteverteilung (in cm⁻²) in einem (001) GaAs-Wafer [Tsai *et al.* 1993]

Versetzungsmuster auf einem (001) GaAs-wafer



Gesamte Versetzungsdichteverteilung (in cm⁻²) in einem (001) GaAs-Wafer für alle 12 Gleitsysteme. Das Photo zeigt zum Vergleich einen KOH-geätzten Wafer.

[Tsai et al. 1993/Jordan et al. 1980]

Empirische Modelle

- Beschreibung der Versetzungsdynamik, praktikable Prozedur zum Verständnis der Prozesse beim Wachstum
- theoretische Fundamentierung ungenügend: empirische Parameter *m*, *K*, *B*
- Prozesse der Versetzungsgeneration nicht verstanden (Wo kommt die erste Versetzung her?)
- Probleme der thermoelastischen Materialeigenschaften bei hohen Temperaturen
- erhöhte Genauigkeit in Berechnung von Spannung/Strain im Kristall erfordert ein dreidimensionales thermo-*plastisches* Modell unter Einbeziehung der Dynamik des Wachstums und der Deformation

Mesoskopische Beschreibung

- Wie kontrollieren elementare Versetzungsmechanismen die Bildung von Versetzungskonfigurationen?
- Multiplikation, Annihilation, Immobilisierung von Versetzungen
- ♦ kooperativer Charakter der plastischen Deformation (Selbstorganisation) →
 Gleitbänder, Versetzungszellen, *persistent slip bands*
- Evolution räumlich modulierter Strukturen eine Eigenschaft von Ensembles mit nichtlinearen Wechselwirkungen
- synergetische Beschreibung der Musterbildung, Nichtgleichgewichtsthermodynamik
- Evolutionsgleichung für Versetzungen [Malygin 1995]:

$$\frac{\partial \rho_i}{\partial t} + \nabla \boldsymbol{j}_i = \boldsymbol{\Phi}_i (\rho_i, \rho_k) \quad \text{mit} \quad \boldsymbol{j}_i = \boldsymbol{v}_i - \hat{\boldsymbol{D}}_i \nabla \rho_i$$

Plastizität und Versetzungen

- Selbstenergie pro Linenlänge $E \approx Gb^3$, in der Größenordnung 1 eV, größer als thermische Energie für Generation topologischer Defekte
- Versetzungen können im Gegensatz zu Punktdefekten nicht im thermischen Gleichgewicht existieren.
- Versetzungen können aufgrund mikroskopischer Instabilitäten (Fluktuationen in den Reibungskräften, Frank–Read-Quellen, Defekte im Versetzungskern, …) nicht von außen beeinflusst werden.
- Es gibt keine reversiblen, quasistatischen Deformationsprozesse.
- Versetzungsdynamik hoch instabil, dissipativ, weit weg vom Gleichgewicht

Versetzungszellen



TEM der Versetzungsstruktur in plastisch deformiertem Molybdän, $\varepsilon = 12 \%$. [Luft *et al.* 1970]

Prinzipien molekulardynamischer Simulation

- molekulardynamische 3D-Simulation mit Versetzungen als lineare Diskontinuitäten im isotropen elastischen Medium [Kubin *et al.* 1998]
- Gleitversetzungen modelliert als diskrete Schrauben- und Stufensegmente
- Versetzungsbewegung als Abfolge der Verschiebung jedes Linienelements im molekulardynamischen Schema unter Wirkung der lokalen effektiven Spannung und der Linienspannung
- τ_{eff}: σ_{int} (Spannungsfelder der Versetzungen), σ_{ext} (externer Spannungstensor), σ_{im} (Bildkrafttensor zur Berücksichtigung von freien Oberflächen), τ_{Peierls} (Reibungskraft als bestimmter Schwellwert)
- Linienspannung: $\tau_{\rm lt} = Gb/R$
- Versetzungskern: Einführung von lokalen Regeln zur Beschreibung des Quergleitens von Schrauben, der Annihilation, der Immobilisierung

Fortschritte in der Simulation

- Gegenwärtige mesoskopische Methoden kombinieren Molekulardynamik und Zellautomatentechniken.
- Zugänglich sind Kristallgrößen bis zu einigen 10 µm im Nanosekundenbereich und Verzerrungen bis zu einigen Zehntel Prozent.
- Überprüfung existierender Modelle, Untersuchung der Selbstorganisation von Versetzungsstrukturen im zugänglichen Maßstab
- Einbau kristallographischer Daten und aller grundlegenden Versetzungseigenschaften

Versetzungstopologie

- Verständnis der Versetzungsdynamik erfordert genaue Kenntnis der Kernstruktur
 ig genauer man hinschaut, umso komplizierter scheint es zu werden
- Struktur und Dynamik von Kinken, Wechselwirkung mit Defekten im Versetzungskern



Aufgespaltene 60°-Versetzung in der Diamantstruktur

Rekonstruktion



Kernstruktur einer 30°-Partialversetzung in Si in der (111)-Gleitebene. *Oben*: Unrekonstruiert, *unten*: rekonstruiert mit Defekt.

Kinkenstruktur



Kinkenpaar (LK und RK) auf der 30°-Partialversetzung

Kinkendynamik

- Struktur und Dynamik von Kinken entscheidend f
 ür Geschwindigkeit des Versetzungsgleitens
- Vielzahl möglicher Kinkenstrukturen mit/ohne gebrochene Bindungen
- Reaktionen mit Rekonstruktionsdefekten,
 z. B. LK + RD ≒ LC, RK + RD ≒ RC
- *ab initio*-Rechnungen ergeben verschiedene Bildungs- und Migrationsenergien der verschiedenen Kinkenstrukturen
- weitere Komplikationen: Wechselwirkungen mit versetzungsgebundenen Leerstellen, Fremdatome, Ladungseffekte

- Quantitative Beschreibung der plastischen Deformation erfordert präzises Wissen darüber, wie sich ein Versetzungsensemble unter Spannung verhält.
- verschiedene Skalen der Beschreibung, die alle ihre Berechtigung haben und in denen weitere Fortschritte erwartet werden
- größtes Entwicklungspotential: Verbindung atomistischer und mesoskopischer Modelle
- erste Molekulardynamiksimulationen mit mehreren 10⁸ Atomen bereits vorgestellt
- fundamentale Einsichten in elementare Eigenschaften der Versetzungen, in Prozesse der Musterbildung, Rissbildung, etc.